

# カンファレンススケジュール

## Conference Schedule

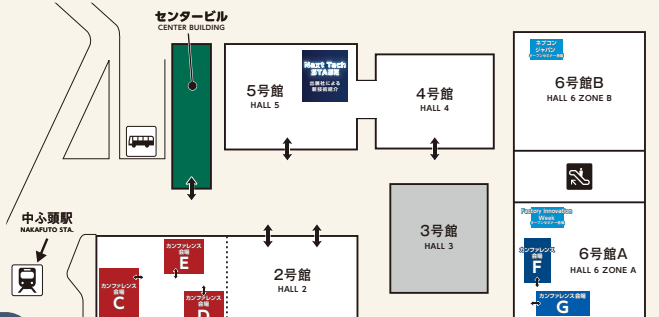
### <注意事項>

- カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
  - ①展示会場入場に必要な来場者パス①
  - ②カンファレンス受講に必要な受講券②

- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- 一部テキスト(講演資料)の配付はございません。
- カンファレンスの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。  
来場登録後にメールにて届く「来場者パス」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。

※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。(印刷・スマホ上でのご提示、どちらでも可)



5月14日[水] Wed. May. 14

インテックス大阪 INTEX Osaka

	カンファレンス会場A	カンファレンス会場B	カンファレンス会場C	カンファレンス会場D	カンファレンス会場E
START	センタービル 2F	2F Center Building	2号館 Hall 2	2号館 Hall 2	2号館 Hall 2
10:00					
10:30					
11:00			11:00-11:45 RCL-K1 循環経済の移行に向けた 産業の最新動向について 循環経済の移行に向けた産業の最新動向について 循環経済の移行に向けた産業の最新動向について 循環経済の移行に向けた産業の最新動向について	11:00-11:45 RCL-1 アルミがなせる、賢やかな世界 ・最新のアルミと材料の最新動向 アルミがなせる、賢やかな世界 ・最新のアルミと材料の最新動向 アルミがなせる、賢やかな世界 ・最新のアルミと材料の最新動向	11:00-11:45 PHOTO-1 IPG社製高出力レーザーの最新技術動向 IPG社製高出力レーザーの最新技術動向 IPG社製高出力レーザーの最新技術動向 IPG社製高出力レーザーの最新技術動向
11:30					
12:00					
12:30					
13:00			12:45-13:30 RCL-K2 成長志向の資源自律経済の 確立に向けた取組について 成長志向の資源自律経済の確立に向けた取組について 成長志向の資源自律経済の確立に向けた取組について 成長志向の資源自律経済の確立に向けた取組について	12:45-13:30 PHOTO-2 レーザー技術加工の基礎と最新動向 レーザー技術加工の基礎と最新動向 レーザー技術加工の基礎と最新動向 レーザー技術加工の基礎と最新動向	12:45-13:30 RCL-2 省のサステナビリティ強化に向けた JX金属の取り組みについて 省のサステナビリティ強化に向けたJX金属の取り組みについて 省のサステナビリティ強化に向けたJX金属の取り組みについて 省のサステナビリティ強化に向けたJX金属の取り組みについて
13:30	13:15-14:45 SUSMA-S1 ラベル産業から「未来社会」を考える 「未来社会」からラベル産業へ ラベル産業から「未来社会」を考える 「未来社会」からラベル産業へ				
14:00					
14:30					
15:00					14:45-15:45 JOLA 産業革命の力学特性評価手法 産業革命の力学特性評価手法 産業革命の力学特性評価手法 産業革命の力学特性評価手法
15:30					
16:00	15:45-16:30 MW-S2 産学連携で力を強化する未来 産学連携で力を強化する未来 産学連携で力を強化する未来 産学連携で力を強化する未来		15:45-16:30 RCL-3 住友化学における炭素資源循環の取組 住友化学における炭素資源循環の取組 住友化学における炭素資源循環の取組 住友化学における炭素資源循環の取組	15:45-16:45 SUSMA-S1 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向	
16:30					
17:00					
	カンファレンス会場F	カンファレンス会場G	オープンセミナー会場	オープンセミナー会場	Next Tech STAGE
START	6号館A HALL 6 ZONE A	6号館A HALL 6 ZONE A	6号館A HALL 6 ZONE A	6号館B HALL 6 ZONE B	5号館 HALL 5
10:00					
10:30					
11:00			11:00-11:30 AIベンチャーコース エンタープライズ向けの 高度な社内セキュリティ対策 エンタープライズ向けの高度な社内セキュリティ対策 エンタープライズ向けの高度な社内セキュリティ対策	11:00-11:30 設計・開発コース Beyond 5Gに向けた 高度な材料開発の技術動向 Beyond 5Gに向けた高度な材料開発の技術動向 Beyond 5Gに向けた高度な材料開発の技術動向	10:30-11:15 EV化・CN化で注目集める IR-フル半導体レーザーの加工応用 EV化・CN化で注目集めるIR-フル半導体レーザーの加工応用 EV化・CN化で注目集めるIR-フル半導体レーザーの加工応用
11:30					
12:00			12:00-12:30 生産・品質管理コース ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか ～先例のない生産現場の課題～ ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか～先例のない生産現場の課題～ ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか～先例のない生産現場の課題～	12:00-12:30 AI技術 World 事例セミナー ＜基盤＞実例から見える AI画像検査の導入前の課題と検討について ＜基盤＞実例から見えるAI画像検査の導入前の課題と検討について ＜基盤＞実例から見えるAI画像検査の導入前の課題と検討について	
12:30					
13:00					
13:30	13:30-14:40 NEPCON-S1 AIの爆発的成長が電子デバイス発展の ベースとなるのか AIの爆発的成長が電子デバイス発展のベースとなるのか AIの爆発的成長が電子デバイス発展のベースとなるのか	13:30-14:40 FIW-S1 ものづくり中小企業のDXとは？ 事例を基にゼロから学ぶ ものづくり中小企業のDXとは？事例を基にゼロから学ぶ ものづくり中小企業のDXとは？事例を基にゼロから学ぶ			
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00	15:45-16:25 NEPCON-S2 DeepSeekの衝撃とビジネスモデル ～新技術の活用とビジネスモデル～ DeepSeekの衝撃とビジネスモデル～新技術の活用とビジネスモデル～ DeepSeekの衝撃とビジネスモデル～新技術の活用とビジネスモデル～	15:45-16:25 FIW-S2 3Dシミュレーションを駆使した ゼロからの自動化導入事例 3Dシミュレーションを駆使したゼロからの自動化導入事例 3Dシミュレーションを駆使したゼロからの自動化導入事例	16:00-16:30 生産・品質管理コース 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向 最新のレーザー技術加工の基礎と最新動向	15:45-16:30 未来・生産コース カーボンニュートラル技術に関する 方策での展示と大阪府によるビジネス化支援 カーボンニュートラル技術に関する方策での展示と大阪府によるビジネス化支援 カーボンニュートラル技術に関する方策での展示と大阪府によるビジネス化支援	
16:30					
17:00					

カンファレンス会場A		カンファレンス会場B		カンファレンス会場C		カンファレンス会場D		カンファレンス会場E		
START		センタービル 2F		2F Center Building		2号館 Hall 2		Hall 2		
10:00										
10:30	10:30-11:15 <b>PLA-1</b> 住友化学と大学との連携で進める 次世代電子デバイス技術の取り組み Sumitomo Chemical Collaborating with Universities in Building Next-generation Electronics Technology		10:30-11:15 <b>PHOTO-3</b> 遠隔2μmレーザの特長とレーザ加工の興廃 Advancement of 2μm Remote Laser and Its Application in Laser Processing		10:30-12:00 <b>MW-S1</b> マテリアルズ・インフォマティクスが切り拓く 新素材材料の開発【パネルディスカッション】 Materials Informatics Opens Up the World of New Materials Development		10:30-11:15 <b>RCL-4</b> 繊維産業における サステナビリティ・実現に向けた取組み Fiber Industry Initiatives to Achieve Sustainability in Textile Industry		10:30-11:15 <b>RCL-S3</b> 基盤インフラに貢献する 超導プラスチックデバイス【RPA】 Superconducting Plastic Device Contributing to Infrastructure	
11:00	住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		フタバインダストリー 康久 俊樹 Futaba Industries Konno Shun		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken	
11:30										
12:00										
12:30	12:15-13:45 <b>RCL-S1</b> 自治体と連携したプラスチック資源循環の 推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Plastic Resource Circulation in Collaboration of Local Governments		12:15-13:00 <b>PHOTO-4</b> レーザ加工でのAI(機械学習)の応用 ～材料選定と品質管理～ Application of Laser Processing in AI (Machine Learning) ~Material Selection and Quality Management~				12:15-13:00 <b>CERA-1</b> 日本が仕における 化合物半導体ウェハへの開発 Development of Compound Semiconductor Wafer in Japan		12:15-13:00 <b>RCL-S3</b> 基盤インフラに貢献する 超導プラスチックデバイス【RPA】 Superconducting Plastic Device Contributing to Infrastructure	
13:00	フリー・オープン・マテリアル・プラットフォーム事務局 事務局の森 樹田 健一 Free-Open-Material-Platform Secretariat Secretariat Mori Kenichi		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken				住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken	
13:30	(株)フタバ工業 スタッフ代表/住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Futaba Industries Staff Representative/Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken				住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken	
14:00										
14:30	14:45-15:30 <b>RCL-K3</b> RecyCreation 再生創造 RecyCreation		14:00-14:45 <b>RCL-6</b> 静電産業における プラスチックリサイクルの取り組みと現状 Plastic Recycling Situation in Electrostatic Industry		13:00-13:45 <b>MW-K</b> フィルム製ベロフスカイト太陽電池の開発と 社会実装に向けた取り組み Development of a Film-type Perovskite Solar Cell and Its Social Implementation		14:00-14:45 <b>RCL-7</b> 三井化学における メカニカルリサイクルの取り組み Mitsui Chemicals' Initiatives for Mechanical Recycling		14:45-15:30 <b>METAL-2</b> モビリティの電動化に貢献する機能材料 Functional Materials That Contribute to the Electrification of Mobility	
15:00	住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken		住友化学 大学 工業技術院 技術本部 高橋 賢 Sumitomo Chemical University Institute of Technology Technical Department Takahashi Ken	
15:30										
16:00										
16:30										
17:00										

カンファレンス会場F		カンファレンス会場G		オープンセミナー会場		Next Tech STAGE				
START		6号館A HALL6 ZONEA		6号館A HALL6 ZONEA		6号館B HALL6 ZONEB		5号館 HALL 5		
10:00	10:00-11:10 <b>INECON-S3</b> 文部科学省の次世代向け 次世代電子デバイス技術の 推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		10:00-11:10 <b>FIW-K</b> 製造業でのAI活用を「やり切る」には ～製造現場で取り入れ～ Generation AI in Manufacturing: Can't Give Up		11:00-11:30 <b>AIベンチャーコース</b> 製造業でのAI活用を「やり切る」には ～製造現場で取り入れ～ The Key to Fully Exploiting Generation AI in Manufacturing: Common Pitfalls in the Testing Phase		11:00-11:30 <b>アダプティブ製造・生産者コース</b> AIやIoTを活用した製造業での 生産者コース AI and IoT in Manufacturing: Producer Course		10:30-11:15 新素材における 次世代技術を用いた未来 The future vision utilizing the new materials	
10:30	サテライト会場: 10:00-11:10 新素材技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of New Materials Technology		日本マテリアル(株) 新素材技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of New Materials Technology							
11:00	文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		ダイキン(株) 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology						ALFABEN (TORRECO JAPAN)	
11:30										
12:00									12:00-12:45 超高純度シリコンが拓く未来 - LSI/MC技術と超高度シリコンの可能性	
12:30	12:30-13:40 <b>INECON-S4</b> 文部科学省の次世代向け 次世代電子デバイス技術の 推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		12:30-13:40 <b>FIW-S3</b> 「製造」の有効活用で切り拓くGXの未来 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		12:00-12:30 <b>カーボンニュートラル計画</b> 東京電力グループによる 工場向けCNソリューションについて The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		13:00-13:30 <b>設計・開発コース</b> DX設計の自動化・最適化 製品に直した解析手法 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		LISTE(株)	
13:00	文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		13:00-13:30 <b>採用強化コース</b> DXで進む現場業務 多様な人材採用を推進 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		13:00-13:30 <b>設計・開発コース</b> DX設計の自動化・最適化 製品に直した解析手法 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology			
13:30	文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		14:00-14:30 <b>生産・品質管理コース</b> ペーパーレスの歩から始める DXの紹介 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		14:00-14:30 <b>実務・生産コース</b> TGVを超えた先進パッケージのための エレクトロニクス加工 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		13:30-14:15 新素材技術の推進【パネルディスカッション】 Q-SUN Xe-8の 紹介と有用性	
14:00					14:00-14:30 <b>採用強化コース</b> DXで進む現場業務 多様な人材採用を推進 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		14:00-14:30 <b>実務・生産コース</b> TGVを超えた先進パッケージのための エレクトロニクス加工 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		三洋電機(株)	
14:30	15:00-16:10 <b>INECON-S5</b> 文部科学省の次世代向け 次世代電子デバイス技術の 推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		15:00-16:10 <b>FIW-S4</b> ロボットの活用で切り拓くGXの未来 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		15:00-15:30 <b>採用強化コース</b> DXで進む現場業務 多様な人材採用を推進 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		15:00-15:30 <b>AIベンチャーコース</b> 製造業でのAI活用を「やり切る」には ～製造現場で取り入れ～ The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology			
15:00	文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		16:00-16:30 <b>保全DXコース</b> 製造業における 設備保全のDX活用 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		16:00-16:30 <b>設計・開発コース</b> DX設計の自動化・最適化 製品に直した解析手法 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology			
15:30	文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		16:00-16:30 <b>採用強化コース</b> DXで進む現場業務 多様な人材採用を推進 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		16:00-16:30 <b>実務・生産コース</b> TGVを超えた先進パッケージのための エレクトロニクス加工 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology			
16:00	文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		文部科学省 次世代電子デバイス技術の推進【パネルディスカッション】 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		16:00-16:30 <b>保全DXコース</b> 製造業における 設備保全のDX活用 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology		16:00-16:30 <b>設計・開発コース</b> DX設計の自動化・最適化 製品に直した解析手法 The Advancing of Next-generation Electronics Technology by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology			
16:30										

	カンファレンス会場A	カンファレンス会場B	カンファレンス会場C	カンファレンス会場D	カンファレンス会場E
START	センタービル2F	2F Center Building		2号館 Hall 2	
10:00					
10:30					
11:00	10:30-11:15 SUSMA-S2 ホダダが目指すリソース・エネルギーシジョンへの 商品技術開発と提供価値 Hoda Products Technology Development and Value Proposition for Resource Circularity （株）ホダダ製品開発 技術開発センター センタービル2階400号室 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hoda, hoda@hoda.co.jp, hoda.co.jp, hoda.co.jp, hoda.co.jp, hoda.co.jp, hoda.co.jp		10:30-11:15 MW-1 ナノ構造制御プロセスによる 新規高性能材料の創出 Development of High-Performance Materials （株）化成材料工業 技術開発部 研究開発 小村 北之 Kobun Chemical Industry, Ltd. Research & Development, Research & Development, Research & Development, Research & Development, Research & Development, Research & Development	10:30-11:15 PHOTO-5 AI（画像処理技術）による 技術の進化と未来展望 Technological Evolution and Future Prospects With AI Image Address Manufacturing CAGI（株）AI技術開発部 廣野 周子 CAGI, cagi@cagi.co.jp, cagi.co.jp, cagi.co.jp, cagi.co.jp, cagi.co.jp, cagi.co.jp	10:30-11:15 METAL-1 鉄鋼業界の脱炭素（低炭素スチール製造） Steel Industry Carbon Reduction (Low Carbon Steel Production) （株）日本製鉄 技術開発本部技術開発課技術開発課 佐藤 智彦 吉田 浩二 JFE Steel, jfe@jfe-steel.co.jp, jfe-steel.co.jp, jfe-steel.co.jp, jfe-steel.co.jp, jfe-steel.co.jp, jfe-steel.co.jp
11:30					
12:00					
12:30	12:15-13:45 PHOTO-5 カーボンニュートラル下の自動車製造への レーザー加工適用と将来展望 [パネルディスカッション] Future Prospects of Laser Processing in Automotive Manufacturing Under Carbon Neutral Society （株）ナテラス 技術センター 技術開発部 大塚 孝幸 佐藤 貴浩 片山 聖二 Natecs, natecs@natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp		12:15-13:45 RCL-52 ケミカルリサイクルの社会実装に向けた CLOMA企業連携[パネルディスカッション] CLOMA Corporate Collaboration for the Social Implementation of Chemical Recycling （株）フロンティアケミカル 技術開発部 佐藤 貴浩 Frontier Chemical, frontier@frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp	12:15-13:45 PHOTO-5 カーボンニュートラル下の自動車製造への レーザー加工適用と将来展望 [パネルディスカッション] Future Prospects of Laser Processing in Automotive Manufacturing Under Carbon Neutral Society （株）ナテラス 技術センター 技術開発部 大塚 孝幸 佐藤 貴浩 片山 聖二 Natecs, natecs@natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp	12:15-13:00 MW-2 新規材料プロセス開発を支援する 先端分析技術 Advanced Analysis Technology Supporting New Material Process Development （株）東洋分析センター 先端分析技術部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Toyo Analytical Center, toyo@toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp
13:00	（株）ナテラス 技術センター 技術開発部 大塚 孝幸 佐藤 貴浩 片山 聖二 Natecs, natecs@natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp		（株）フロンティアケミカル 技術開発部 佐藤 貴浩 Frontier Chemical, frontier@frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp	（株）東洋分析センター 先端分析技術部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Toyo Analytical Center, toyo@toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp	
13:30	（株）ナテラス 技術センター 技術開発部 大塚 孝幸 佐藤 貴浩 片山 聖二 Natecs, natecs@natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp, natecs.co.jp		（株）フロンティアケミカル 技術開発部 佐藤 貴浩 Frontier Chemical, frontier@frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp, frontier-chem.co.jp	（株）東洋分析センター 先端分析技術部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Toyo Analytical Center, toyo@toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp, toyo-analytical.co.jp	
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00	15:45-16:30 SUSMA-M4 二酸化炭素を原料とした 生分解性バイオポリマーの生産 Production of biodegradable polymer （株）JCOM CO2 Innovation Laboratory 佐藤 貴浩 佐藤 大志 JCOM, jcom@jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp				
16:30	（株）JCOM CO2 Innovation Laboratory 佐藤 貴浩 佐藤 大志 JCOM, jcom@jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp, jcom.co.jp				
17:00					

	カンファレンス会場F		カンファレンス会場G		オープンセミナー会場		Next Tech STAGE			
	6号館A		HALL 6 ZONE A		6号館A HALL 6 ZONE A		6号館B HALL 6 ZONE B		5号館 HALL 5	
10:00	10:00-11:10 <b>NEPCON-S6</b> チップレット技術や独自設計の 半導体開発について徹底解説 Highly Efficient Chiplet Technology and Independent Semiconductor Development （株）NEC 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 NEC, nec@nec.com, nec.com, nec.com, nec.com, nec.com, nec.com		10:00-11:10 <b>FIW-S5</b> 製造業の未来を切り開く人材戦略 〜大卒・中卒企業から実務を学ぶ〜 Human Resource Strategy for Manufacturing Industry （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp							
10:30										
11:00					11:00-11:30 <b>保全DXコース</b> ファストデジタルツインが切り拓く、 新しい設備保全とは Fast Digital Twin for Asset Management （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp		11:00-11:30 <b>実装・生産コース</b> X線による実装基礎の不良解析 （不良を未然に防ぐために、不良率から学ぶこと） X-ray Inspection for Assembly Defect Detection (Learning from Defect Rate to Prevent Defects) （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp			
11:30										
12:00										
12:30					12:00-12:30 <b>生産・品質管理コース</b> 製造現場で活用できるデジタル人材の育成とは 〜現場から学ぶデジタル人材の育成〜 Digital Talent Development for Manufacturing Industry （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp		12:00-12:30 <b>Alltech World 事例セミナー</b> 「導入・運用」-実例から見える AI/機械学習の導入の課題と解決について AI/ML Implementation Case Study: Challenges and Solutions （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp			
13:00	12:30-13:40 <b>NEPCON-K</b> AI時代における 最先端パッケージング技術の展望とは AI Era and the Prospect of AI Packaging Technology （株）NEC 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 NEC, nec@nec.com, nec.com, nec.com, nec.com, nec.com, nec.com		12:30-13:40 <b>FIW-S6</b> 製造業で活躍するデジタル人材の育成とは 〜最先端の取組みから学ぶ〜 Digital Talent Development in Manufacturing Industry （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp				13:00-13:40 <b>アパチミツ研究開発成果発表コース</b> 大規模AI時代における 先端技術の発展と展望 Large AI Era and the Prospect of Advanced Technology Development （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp			
13:30	（株）NEC 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 NEC, nec@nec.com, nec.com, nec.com, nec.com, nec.com, nec.com		（株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp						13:30-14:15 SDG&に貢献するディスプレイ技術と 環境技術について SDG& Contributing Display Technology and Environmental Technology （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp	
14:00					14:00-14:30 <b>カーボンニュートラル初級編</b> 社会課題（脱炭素・人材不足）を 同時解決するソリューション Carbon Neutrality and Talent Shortage Solutions （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp		14:00-14:30 <b>設計・開発コース</b> 電子設計/PCMCによるQCD向上の戦略と実践 〜最終コスト削減を達成するための実践〜 Electronics Design/PCMC for QCD Improvement Strategy and Practice （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp			
14:30	14:30-15:05 <b>NEPCON-S7</b> 最先端機器に学ぶ最先端半導体の冷却技術 Advanced Technology for Advanced Semiconductor Cooling Technology （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp		14:30-15:05 <b>FIW-S7</b> 中堅・中小企業のGXを後援する 断片的GX支援プロジェクトについて Supporting Mid-Sized and Small Enterprises' GX with Fragmented GX Support Projects （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp				15:00-15:30 <b>カーボンニュートラル初級編</b> 製造業のカーボンニュートラルに貢献する 最先端のMeisterシリーズ Carbon Neutrality and Talent Shortage Solutions （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp			
15:00	（株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp		（株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp							
15:30										
16:00										
16:30							16:00-16:30 <b>アパチミツ研究開発成果発表コース</b> マイクドメイン・ミリ波帯ドメインで MOSFETの進展 Microwave Domain and Millimeter Wave Domain Progress of MOSFET Development （株）日立製作所 技術開発部 佐藤 貴浩 佐藤 大志 Hitachi, hitachi@hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp, hitachi.co.jp			
17:00										

3/3